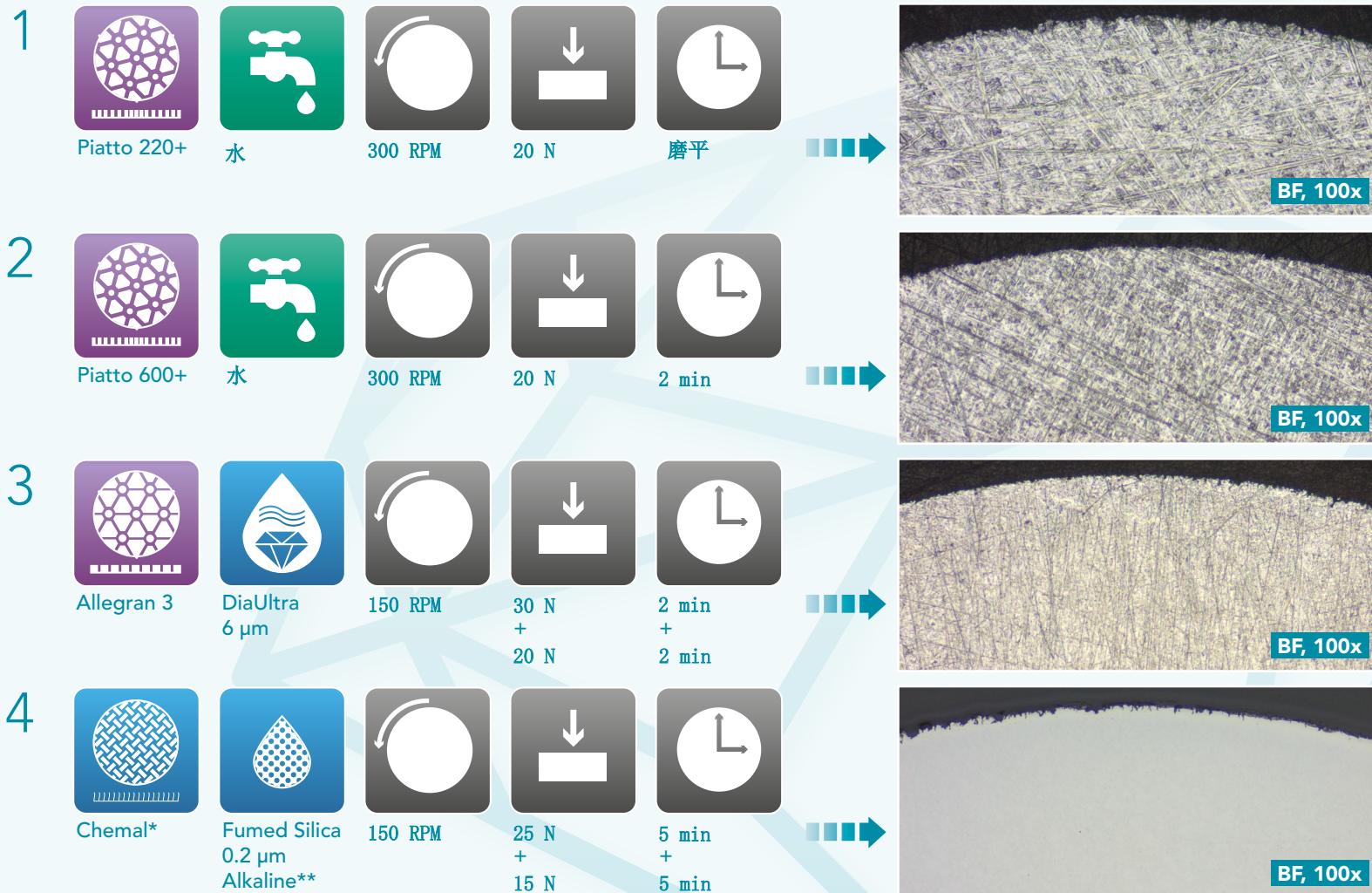


# Aka-Brief #3 纯钛



图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

\*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

\*\*96毫升 Fumed Silica,  
2毫升  $H_2O_2$  (30%),  
2毫升  $NH_4OH$  (25%).

这种混合物应该在新鲜时使用（几个小时之内），并定期搅拌。

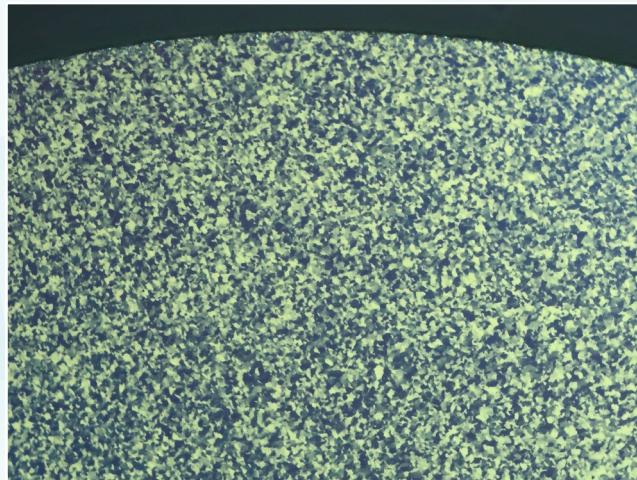


# Aka-Brief #3 纯钛

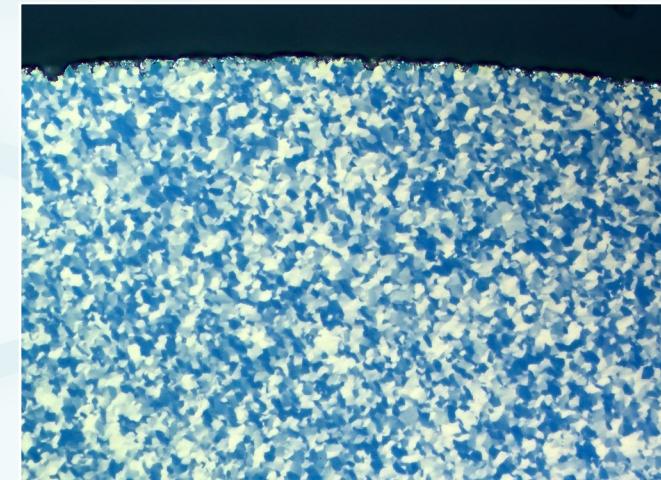
## 最终制样结果



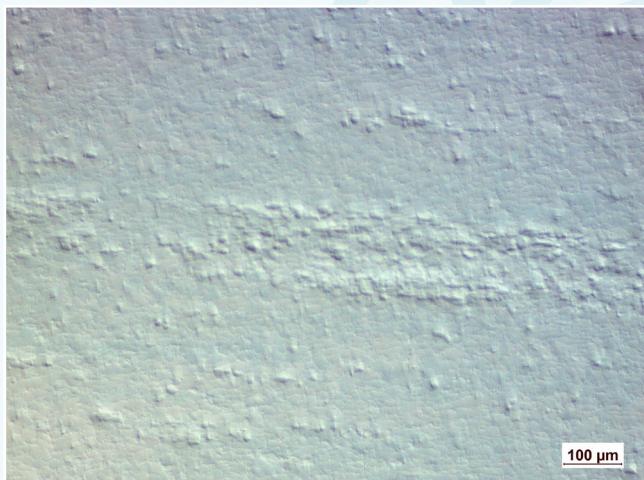
四级纯钛，微分干涉衬度像，100倍



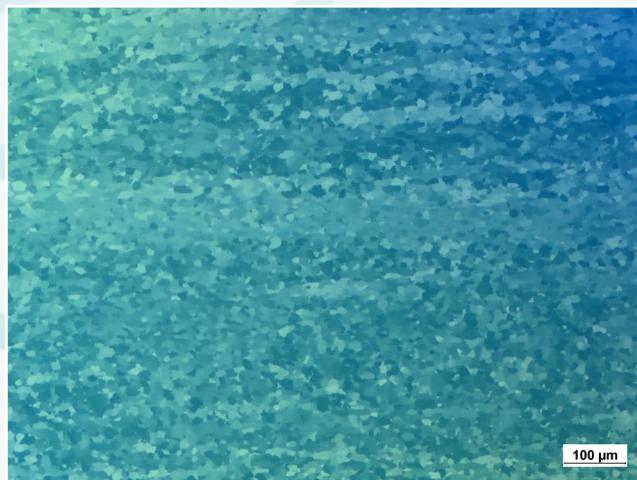
四级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，100倍



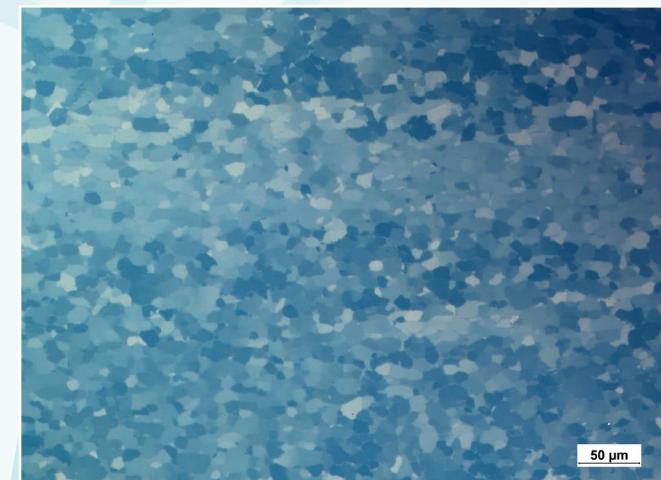
四级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，200倍



二级纯钛，微分干涉衬度像，100倍



二级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，100倍



二级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，200倍